

## Nicht publizierte Veröffentlichungen

### 3. Artikel

Design of polymers for thermal nanoimprint lithography based on rheological investigations. I.

García Romero\*, F. Reuther, M. Fink, G. Gruetzner. EIPBN, 2008

Ursache: Geheimhaltungsvereinbarung mit der Firma micro resist technology GmbH

### 4. Artikel

Rheological characterisation and tuning of polymers for nanoimprint lithography. I. García

Romero\*, F. Reuther, M. Fink, G. Gruetzner. MNE, 2008

Ursache: Geheimhaltungsvereinbarung mit der Firma micro resist technology GmbH